

Vide ▶ Couches minces PVD ▶ Contrôle d'étanchéité ▶ Plasma



Equipement de dépôt de couches minces multicathodes

DP 850



Destiné à la production en grande série d'échantillons nécessitant une qualité optimale

De par ses dimensions le système DP850 est orienté vers la production. Pouvant recevoir jusqu'à 6 cathodes magnétron de 200 mm, il permet la réalisation de multicouches complexes.

Le sas d'introduction permet d'optimiser les temps de cycle et la qualité des films déposés.

Nous avons réalisé quelques exemplaires de ce système de 850 mm de diamètre pour des applications de recherche qui requièrent une configuration avec par exemple plus de 10 cathodes de 2".



Caractéristiques générales

Diamètre enceinte :	850 mm
Hauteur :	320 mm
Volume :	Environ 190 litres
Vide limite (configuration turbo + palettes) :	5.10^{-7} mbar ^[1]
Vide limite (configuration cryogénique) :	5.10^{-8} mbar ^[1]
Capacité machine :	6 positions 100 mm
Uniformité planar :	< +/- 5% ^[1]
Implantation passe-paroi :	Oui
Possibilité sas :	Oui
Pilotage machine :	- Gestion des procédés - Traçabilité

^[1] Ces valeurs sont des valeurs mesurées sur des équipements réalisés et sont données à titre indicatif car sont tributaires de la configuration finale de chaque équipement.

